**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 高真空单靶磁控溅射镀膜机 | 台 | 1 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 高真空单靶磁控溅射镀膜机 | 1. \*真空腔室210mm×H310mm，材料304不锈钢，焊缝用氩弧焊接，镀膜腔室内表面抛光。 2. \*2.1.涡轮分子泵+直联旋片泵抽真空，分子泵抽速110 L/S，旋片泵抽速3L/S。   \*2.2极限真空度优于8.0×10-5Pa，从大气抽至6.0×10-3Pa≤30min。  2.3主气路使用DN100mm手动节流阀，GDC-25高真空电磁挡板阀，Φ6mm电磁截止阀。   1. \*2英寸圆形磁控平面靶，向上溅射。50mm基片上镀膜均匀性≤±5%，配备5000W直流偏压电源和500W射频电源各一套。 2. 4.1.基片台转速0-20转/分钟连续可调，磁流体动密封。   #4.2铠装加热器，加热温度从室温至400°C，K型热电偶测温。PID温控仪控温，精度1°C。  4.3基片台能加最高负1000V偏压，实现基片清洗。   1. “一低一高” 数显复合真空计，测量范围从1×105Pa到1×10-5Pa；一路50sccm质量流量控制器，数显流量控制显示仪，不锈钢气路，配两路针阀。 2. 电气控制系统控制各设备的开与关，包括总电源、机械泵、前级阀，分子泵，真空计，基片台温控仪，溅射电源参数显示及开关。缺水、水压过低情况下的报警。 | 台 | 1 |

标注\*号指标为核心指标，必须满足，否则报价将不被接受。标注#号指标为重要指标。

**3、质保及售后服务要求**

3.1 产品质保期为一年，质保期内设备的维修免费，质保期内设备原因引起的零配件更换免费。所有配件、备件质保期外按成本价长期提供。

3.2 在接到用户要求进行技术支持的正式通知（含电话或邮件通知）后，于24小时内给出答复。如有必要48小时内，赶到技术服务现场。

3.3供方派技术工程师对需方人员进行技术培训。使需方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.4 供方提供详细的培训课程讲义及培训。